

穴澤紀道 (アナザワ ノリミチ)

株式会社ホロン社長



ニュー・ホロン創生に向けて、 技術力を軸に各種事業戦略を展開

◆減損会計の適用、第三者割当増資等を実施

3期連続の赤字であったため、2008年3月期（当期）決算において減損会計を適用し、2億9百万円の減損損失を計上した。また、役員退職慰労引当金全額1億36百万円を取り崩した。さらにこの3月に、第三者割当増資により約2億円の資金調達を行った。

当期の損益は、2月に発表した修正予想値との比較で見ると、売上高3億円の予想に対し実績は3億6百万円と、若干増えた。これはサービスの売上が予想を上回ったことによるものである。しかし、利益については予想よりもマイナスが増えてしまっている。これは売上原価が想定以上に増えたことと、前述した第三者割当増資の際の費用が予定より膨らんでしまったことによるものである。

前期比で見ると、2007年3月期の売上高5億66百万円に対し、当期は3億6百万円で、マイナス2億60百万円となった。一方、営業利益および経常利益については、試験研究費や人件費等、経費の削減努力により、前期と比較して赤字が少なく済んでいる。また、原価面で改善が見られた関係で、売上の割には、前期と比較して利益が改善している形である。しかし前述の減損会計適用により、純利益は前期に比べてマイナスが増えている。

営業損失は前期の4億円に対し、当期は3億26百万円と、74百万円の改善が見られた。これは前期比2億60百万円の減収でありながら、売上原価が1億94百万円、販管費が1億40百万円、それぞれ減少したことによるものである。

資産状況を見ると、前期は18億85百万円あったものが、当期は13億37百万円に減少している。内訳としては、現預金が6億25百万円から4億91百万円に、また、売上債権が2億68百万円から64百万円へと一気に減少したが、その一方で、在庫が5億63百万円から6億28百万円に増えているため、流動資産はトータルで15億4百万円から11億91百万円に減少している。また、有形固定資産は減損会計により2億72百万円から94百万円となり、結果として固定資産部分はトータルで3億81百万円から1億46百万円に減少している。現預金および売掛金が減り、在庫が増えるという悪い流れから一刻も早く抜け出し、在庫を現預金や売掛金の方に持っているのが、当社の一番の使命と考える。

負債と資本の状況を見ると、流動負債については前期の3億25百万円から、当期は1億28百万円となっている。その主な理由としては、買掛金の減少と短期借入金を一気に返済したことが挙げられる。また、固定負債については2億40百万円から94百万円に減少している。これは冒頭で述べた役員退職慰労引当金の取り崩しが主要因となっている。また、純資産は13億19百万円から11億14百万円に減っている。第三者割当等により資金調達をし、資本金や資本準備金は増えたものの、当期純損失が4億9百万円であった関係から、結果として、純資産もマイナスとなったわけである。

現金および現金同等物の残高は前期末の6億25百万円から、当期末には4億91百万円となっている。その要因としては、営業活動によるキャッシュフローがマイナス2億6百万円になったことが挙げられる。当期純損失が税引前で4億7百万円あったことと、役員退職慰労引当金を取り崩したことがマイナスの要因である。逆にプラスの要因としては、減損損失の計上や、売掛金の減少などが挙げられる。投資活動によるキャッシュフローの減少（10百万円）は、前期に計上した固定資産の支払いが当期にずれしたことなどによるものである。また財務活動によるキャッシュフローは、負債のところで述べたように、借入金を返済したことによるマイナス分と前述の資金調達によるプラス分とで、差し引き82百万円ほどの増となった。

販管費については、前期の5億81百万円に対し当期は4億41百万円となっている。これは経費削減を全社で取り組んでいる成果である。減少要因として、試験研究費を2億66百万円から1億92百万円に、人件費を1億45百万円から1億29百万円に、それぞれ縮小したことが挙げられる。

受注実績の状況としては、前期の6億1百万円から、当期は4億22百万円となっている。ただし下期受注の「EMU」1台が、現在、受注残という形で残っている。前期までの受注低下は競合他社に負けたという感じで

あったが、当期については状況が異なり、ユーザーが設備投資を先送りしているのではないかという感触があり、時期はまだ見えないが、今後、受注が出てくるものと考えている。

◆進化した「EMU」と新規開発の「EBLITHO」で巻き返しを

業績悪化の原因として、まず、主力製品である「EMU-270A」の技術評価が、年度前半の商機に間に合わなかったことが挙げられる。年度後半にはその遅れをばん回し、高性能機として評価を受けたが、既に各メーカーが業績悪化から設備投資の順延を決定しており、販売の機会を逸してしまった。さらには、「EMU」に代わると期待された電子スタンパー「EBLITHO」についても、レジストプロセスの経験不足から評価が遅れ、販売に結び付けることができなかった。

これらの反省から、今期の目標は、「EMU」の進化をアピールし、順延している商談の早期成立を目指すことである。また、「EBLITHO」についてはレジストメーカーを巻き込んで、顧客のニーズに見合う製品を開発し、受注獲得に結び付けたいと考えている。当社の開発状況および顧客各社の購入計画等の情報を分析した結果、今期の売上高は8億70百万円を見込んでいる。

◆ニュー・ホロンの創生～その基本方針と営業戦略～

当社は創設以来、変化に対応できる個人重視の考え方をもって会社を運営してきた。技術者は少数ではあるが精鋭で、個々の能力を最大限に発揮しているものと自負している。しかしながらここ数年、個人の力が集団の力としてうまく機能していないようである。スモール・カンパニーであるからこそできることを、もう一度見直し、俊敏性を生かしたいと考えている。

そこで開発・技術統括、設計・製造統括および営業担当役員を新たに任命し、経営体制を見直した。指揮系統を明確にし、市場の動向やユーザーの要求に敏感に反応できる営業と、それを的確かつ敏速に製品開発に結び付けることができる製造技術確立したい。企画開発から製品化までのスピードアップを図り、ユーザーに対してスピーディーなサービスと信頼を提供できる会社づくりを目標に、新たな取り組みを開始している。

フォトマスク用CD-SEM市場は、微細化技術としては半導体のみならず、MEMSも含め、急速に拡大している。ナノオーダーの観測・加工技術は、ますます重要になるであろう。技術力および営業力の向上とともに、主力製品における競争力強化のため、積極的に他社との技術提携を進めたいと考えている。本年3月に実行した第三者割当増資の引受先である(株)イー・アンド・デイとの共同開発については、既に技術者レベルでの検討会を始めており、両者の特色技術を生かした新しい製品開発に取り組んでいる。

◆「EMU」の性能アップと「EBLITHO」のLED市場投入、製品ラインアップの充実により、業績の向上と安定化を目指す

今後の展開において基本となるのは、絶えざる競争に勝ち抜くための主力製品「EMU」の性能アップである。低真空機能と収差補正機能を織り込んだ「EMU-270A」は、飛躍的な性能アップを実現し、現在の最先端リソグラフィーで使用されるマスクはもちろん、次世代リソグラフィーにおいて採用されるであろうナノインプリント・モールドに対しても、チャージフリーで高分解能な画像取得と測定を可能としている。

電子スタンパー「EBLITHO」については、新技術であるナノインプリントとの競合になりつつあるが、低価格で高処理能力という、当社の装置の特徴を生かす製品開発を進めている。当期、LEDメーカーに納入したが、さらなる拡販のためにレジストメーカーの協力を得て、レジストプロセスの共同開発をスタートした。この共同開発の推進により、次のステップである本格的な量産タイプに向けて、開発と販売促進が可能になると考えている。

また、現在、当社の製品構成はマスク用CD-SEMに大きく依存しているため、同装置の販売動向によって業績も大きく変化するリスクを抱えている。この業績変動を少なくするには、製品ラインアップの充実が急務であると考えられる。当社の保有する電子ビーム技術の応用によって、マスクCD-SEM以外の新製品を開発し、新しい柱となる製品を育てていく必要がある。当社の得意技術である絶縁物表面の高精度測定技術を応用し、現在急速に発展しつつあるナノインプリント超微細モールドの検査・測定装置を開発中である。

半導体産業で熟成された微細加工技術は、半導体以外の分野にも応用されるようになった。サブミクロン以下のナノメーターの世界では、光による観測・測定は不可能になりつつあり、各種分野において、今、当社の得意技術を生かすチャンスが訪れようとしている。

◆ 質 疑 応 答 ◆

LED向けの受注の見通しについてお聞きしたい。

ナノインプリントとの競合になっており、工場ベースでの量産については、今のところ五分五分ではないかと考えている。半導体を狙ったものからMEMSに至るまで、非常に多岐にわたるため、どこを狙うかも、これからの課題になるだろう。

今期の売上高を8億70百万円と見込んでいるが、その中身として、主要製品の実数はどれくらいを想定しているのか。

これは「EMU」を2台、「EBLITHO」を2~3台として積算した値である。

(平成20年5月14日・東京)